科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 27 年 6月 16 日現在

機関番号: 1 3 8 0 1			
研究種目: 基盤研究(C)			
研究期間: 2012 ~ 2014			
課題番号: 2 4 5 6 0 8 0 1			
研究課題名(和文)GGA-FPKKR法の第一原理計算による遷移金属シリサイドの電子構造・磁性			
研究課題名(英文)GGA-FPKKR Calculations for Electronic and Magnetic Structures of Transition-metal			
STITCIDES			
研究代表者			
至野 敬存(HOSNINO, IOSNINARU)			
研究者番号:70157014			
交付決定額(研究期間全体)・(直接経費) 4 200 000円			

研究成果の概要(和文):正6面体B20構造の遷移金属シリサイドXSi(X=Cr,Mn,Fe,Co)は、X元素の選択により多様な磁性・電気伝導性を示す。最近、FeSiとCoSiを混合したFe(1-c)Co(c)Siの磁性について詳しく調べられ、ハーフメタル特性の工業材料として期待されている。本研究では、我々の開発したGGA-FPKKR計算プログラムで、XSiとFe(1-c)Co(c)Si の磁性・電気伝導性を再現し、その微視的機構を明らかにした。 また、遷移金属シリサイドの格子歪効果を調べる準備として、単元素金属Fe中の不純物原子(Sc-Ge)系の格子歪効果を 調べように計算プログラムを整備し、格子歪効果を調べた。

研究成果の概要(英文): It is well known experimentally that the cubic B20 structure transition metal monosilicides XSi(X=Cr,Mn,Fe,Co) exhibits a wide variety of magnetic and transport behavior, such as CrSi(non-magnetic(NM) metal), MnSi(ferromagnetic(FM) metal), FeSi(NM semiconductor with a small gap), and CoSi(NM semimetal). It is also known that the mixtures Fe(1-c)Co(c)Si of FeSi and CoSi become FM at intermediate concentrations although both extrema are NM. It is recently shown that the Fe(1-c)Co(c)Si disordered alloys present a remarkable behavior of half-metallicity in the Fe-rich region. We successfully reproduced the fundamental features of the magnetic and electronic properties of XSi and Fe(1-c)Co(c)Si, using ab-initio calculations based on the GGA in the density functional theory and the full-potential Korringa-Kohn-Rostoker Green's function method.

the distortion effect in the prsent systems.

研究分野:物性理論、計算物理

キーワード: 第一原理計算 Screend-FPKKR 密度汎関数法(GGA) 遷移金属シリサイド 磁性 電気伝導性 ハーフ メタル 格子歪

1.研究開始当初の背景

正六面体 B20 構造(図1)の遷移金属シリ サイド2元合金 XSi (X=Cr, Mn, Fe, Co) は、X 元素の選択により多様な磁性・電気 伝導性を示すことが実験的に分かっている。 X = Cr の場合は、非磁性金属、X = Mn の場 合は強磁性金属、X=Fe の場合は非磁性半 導体(小さなバンドギャツプ) X=Coの場 合は非磁性半金属である。最近、それらを 混合した3元合金 X_{1-c}Y_cSi (X,Y=Mn, Fe, Co)の磁性・電気伝導性が調べられ、新しい 工業材料として期待されている (図2)。例 えば Fe1-cCocSi は、c=0, 1 (FeSi, CoSi) では、非磁性であるが、c=0.08~0.80 で強 磁性になり、c=0.10~0.25 でハーフメタル 特性を示す。また、Mn1-cFecSiは c=0.25 ぐ らいまでは磁性を示すが、それ以上の濃度 では、非磁性である。これらの遷移金属シ リサイドの多様な磁性・電気伝導性につい て、原子レベルでの統一的理解が強く望ま れている。





図 2 (Nature 404,581(2000))

2.研究の目的

上記の遷移金属シリサイド(2元合 XSi (X=Cr, Mn, Fe, Co)とその混合物)の磁性・ 電気伝導性を理論的に明らかにすることは、 新しい磁気メモリなどの材料開発のために 重要である。また、これらの系では、anti-site (X-site にY元素が入る欠陥)、swap(X-Yの 原子位置交換)とそれに伴う格子歪効果を調 べることも重要と思える(J. Alloy. Compd., 504S (2010), S531-S533)。

本研究の目的は、下記である。

- (1) 遷移金属シリサイド(2元合 XSi(X=Cr, Mn, Fe, Co)とその混合物の磁性・電気伝 導性の実験結果を第一原理計算で再現し、 その微視的機構を原子レベルで明らかに する。
- (2) これらの材料で重要と思える格子欠陥 効果を研究できるように、本研究の第一原 理計算プログラムを開発・整備する。また、 我々の提案した内部エネルギーの実クラ スター展開(J. Alloy Compd., 504S (2010), S534-S537)と原子配置エントロピーのク ラスター変分法(CVM)で、遷移金属シリ サイドの平衡状態図を求める計算の準備 として、CVM のテトラヘドロン近似 (Mter. Trans. 42 (2001), 2216-2224)を超 える計算プログラムを作成する。具体的に は、2体の原子間相互作用は一般的に長距 離性を示すので、第4近接の不純物原子間 相互作用エネルギーまで考慮できるよう に、CVM 計算プログラムを改良する。
- 3.研究の方法

ドイツ・ユーリッヒの Dederichs 教授グル ープとの共同研究で開発した密度汎関数法 の一般化密度勾配近似 (Generalized Gradient Approximation(GGA))を基礎とする Full-Pot -ential Korringa-Kohn-Rostoker (FP KKR) グリーン関数法の第一原理計算で、遷移金属 シリサイドの電子状態密度を求め、磁性・電 気伝導性を調べる。GGA-FPKKR 計算プログ ラムは母体用 (Screened-KKR 版;短距離性の Green 関数使用)と不純物系用の2段階に分 かれている。不純物系の計算では、super-cell 近似などを使用せずに、無限結晶中の不純物 が正確に扱える。

(1) 母体計算用 Screened-KKR 計算で、遷移 金属シリサイドの2元合 XSi(X=Cr, Mn, Fe, Co)とその混合物の系の電子状態を求め、 その磁性・電気伝導性を統一的に理解する。
(2) 遷移金属シリサイド系の格子歪効果を 扱う準備を行う。先ず、Fe(bcc 構造) AI (fcc 構造)中の不純物系の格子歪を扱え るように不純物系用計算プログラムの開 発・整備を行う。

遷移金属シリサイド FeSi は非磁性半導体 で、非常に小さいバンドギャップ(0.1eV ほ ど)が存在する。本研究の Green 関数法の計 算では、絶対0度での物理量(全エネルギー、 磁気モーメントなど)を正確に簡単に求める ため、フェルミ分布の有限温度の計算を行う。 具体的には、エネルギー積分は複素数面のエ ネルギーに拡張し、留数計算を行っている。 バンドギャップが小さい場合には、磁気モー メントの温度依存性が大きいので、フェルミ 分布の温度依存性を調べる必要がある。また、 電子状態密度(DOS)の計算も、複素数のエ ネルギーZ=E+i (E は実エネルギー、 は 複素数部分の大きさで、本研究では = kT の関係がある(Tは温度))上で計算してお り、バンドギャップが存在する場合には、 依存性を調べる必要がある(下記の図4の説 明参照)。先ず、フェルミ分布の温度依存性 と DOS の 依存性について示す。

フェルミ分布の温度依存性

Fe_{0.75}Co_{0.25}Si, Fe_{0.5}Co_{0.5}Si の磁気モーメント のフェルミ分布の温度依存性を図 3 に示す。 比較のため、Fe,Ni,Co₂MnSi(フルホイスラー 合金、バンドギャプが 1eV ほど)の磁気モー メントも示す。T=200K で、T=0K の値をほ





図 3



ぼ1%の誤差で再現している。格子定数などは、T=800Kでほとんど収束している。よって、本研究ではT=200Kのscf計算で求めた物理量を示す。

<u>DOSの依存性</u>

FeSiのDOSの 依存性を図4で示す。 依存性は大きく、 = 0.8mRy(T=40K)で、 ほぼT=0Kのバンドギャップが再現されてい る。

本研究で得られた結果を下記に示す。また、 本研究の論文作成状況などをこの節の最後 で説明する。

(1) 格子定数

GGA 計算で、格子定数の実験結果を1% 以内の誤差で再現した(表1)。密度汎関数 法の局所密度近似(LSDA)では2%ほど、過 少評価することも分かった。

表1

格子定数(Å)		
	Expriment	GGA
CrSi	4.62	4.60
\mathbf{MnSi}	4.56	4.52
FeSi	4.48	4.45
CoSi	4.44	4.45

(2) <u>XSi(X=Cr, Mn, Fe, Co)合金の DOS (非 磁性)</u>

遷移金属シリサイド XSi (X=Cr. Mn. Fe. Co)の磁性・電気伝導性が本研究の計 算で得られた非磁性状態の DOS (図5、 = 4mRy) で説明できる。DOS の大まか な特徴は X に依らずほとんど同じである。 フェルミ準位近傍に4つのピーク(a,b,c, d) があり、Cr→Mn→Fe→Co と X の変化 に応じて、遷移金属原子当たり電子数が1 個づつ増え、フェルミ準位がピークbの下 からピーク c の上に移動する。FeSi のフェ ルミ準位は b と c の間の谷、CoSi のフェ ルミ準位はcとdの間の谷に位置する。 = 0.4mRyのDOS (図6(a))を見れば、 FeSi のフェルミ準位はギャップ中に位置 する。一方、CoSi (図 6(b))のフェルミ準位 近傍では DOS の値が小さくはなるが 0 に はならず、CoSi は半金属的になることが わかる。また、MnSi のフェルミ準位はピ ークbの位置にあり、ストーナ条件より磁 性になると予測できる。スピン偏極を考慮 した計算で強磁性が基底状態となること を確かめた((6)参照)。一方、CrSi は非磁性 状態が基底状態である。







図 6

(3) <u>規則相 Fe_{1-c}Co_cSi 合金 (c = 0.25,0.50)</u> の電子状態と磁性

規則相 Fe0.75C00.25 は強磁性状態が基底状 態である。その DOS を図6(c)に示す。多数 スピン状態は金属的であるが、少数スピン状 態は半導体となり、磁気モーメントは1µBで ある。単位胞の4個のFeの1個がCoになり、 電子数が1個増えるが、その増加分はすべて 多数スピン状態の増加となる。Fe0.5C00.5Si も 基底状態は強磁性状態で(図6(d)) 磁気モ ーメントは 2μB である。4個のFeの半分(2 個)が Coになり、2個の電子数の増加はすべ て多数スピン状態の増加となる。

(4) <u>不規則相 Fe_{1-c}Co_cSi 合金のモーメント:仮</u> <u>想 2 元合金近似での模型計算</u>

3元合金 Fe1. Co.Si を2元合金 MSi で近 似し、その磁気モーメントを求めた(図7)。 仮想原子Mの原子番号Z_MをFe原子の原子番 号 Z_{Fe}と Co 原子の原子番号 Z_{Co}の濃度平均と する (Z_M = (1 - c) Z_{Fe} + cZ_{Co})。この近似で は、3元合金の荷電子数は保存される。 c=0.084 で磁性が発現し、0.1≤c≤ 0.5 でハー フメタル特性を示す。Co濃度の小さいときは、 実験値を再現している。c=0.25辺りまではハ -フメタル(磁気モーメントは、単位胞当た り 1µB、遷移金属原子当たり 0.25µB)になっ ており、実験結果に合う。しかしながら、c=0.5 辺りでも、この模型計算ではハーフメタルに (磁気モーメントは、単位胞当たり 2µB)に なり、実験結果とは大きくずれる。この違い は、仮想2元合金近似では、Co原子の析出効 果を無視していることによる(((5)参照)。 CoSi, FeSi は非磁性であるので、析出効果が 大きければ、平均値の磁気モーメントが大き な減少することが期待できることは明らか である。



図 7

(5) <u>不規則相 Fe_{1 - c}Co_cSi(c=0.25, 0.5)合金</u> の析出効果

析出効果を調べるため、2 倍の単位胞(図 8、単位胞当たり 16 原子を含む)で、Fe と Coの原子配置をいろいろ考えて、そのボルツ マン近似で磁気モーメントを計算した。Co 濃度が増えると、その効果は大きく、c=0.5 辺りでは、遷移金属原子当たり磁気モーメントは、仮想2元合金近似の0.47µbから0.28µbと減少し、実験結果(0.15µb)にかなり近づく。c=0.25の低濃度では、0.25µbが0.24µbとなり析出効果はほとんど無視できる。

ボルツマン分布による磁気モーメントの計

2倍のunit cell 内でいろいろな原子配置を考慮す。



•TM(Fe or Co) 8個のTMサイトにCoが4個ある Si

原子配置の数は、8C4=70。

$$\mathbf{M}_{ave}(\mathbf{T}) = \frac{\sum_{i} \mathbf{M}_{i} \times \mathbf{N}_{i} \times \exp(-\frac{\Delta \mathbf{E}_{i}}{\mathbf{kT}})}{\sum_{i} \mathbf{N}_{i} \times \exp(-\frac{\Delta \mathbf{E}_{i}}{\mathbf{kT}})}$$

原子配置のエネルギー差は数mRy/double unit

図 8

 (6) <u>不規則相 Mn_{1-c}Fe_cSi 合金のモーメント:</u> <u>仮想 2 元合金近似での模型計算(予備的</u> <u>計算)</u>

不規則 Mn_{1-c}Fe_cSi の磁気モーメントの濃度 依存性を仮想 2 元合金近似での模型で調べ た。MnSiの磁気モーメントはほぼ合うが、 Fe濃度が増えると実験値とのずれは大き くなる。単位胞 2 倍で、Mnの反強磁性の配置 を考えれば、磁気モーメントは大きく減少し そうである。

(7) <u>3元合金 X_{1-c}Y_cSi (X, Y = Mn, Fe, Co)</u> の磁性に及ぼす格子歪計算の準備

上記の系の格子歪効果を調べるように、 本研究計算プログラムの整備を行なった。 先ずは準備として、Fe中の1不純物による 体積変化、不純物まわりの局所格子歪、格 子歪エネルギーを調べた。Fe中のMn不純 物の場合、反強磁性状態が安定であること が分かった。また、Mn-Mn対の不純物の場 合は、Mn-Mnの反強磁性状態が安定である。 また、Al中のMn、Fe、Co不純物などの格 子歪効果を調べ、Alと遷移金属不純物原子 間の sp-d ボンドは、Al-Alのボンド長より 短くなること(格子歪効果)で強くなること を明らかにした。将来は、3元合金中の不純 物の計算で、格子歪と磁性を調べる予定で ある。

(8) <u>遷移金属シリサイドの平衡状態図計算の</u> <u>準備</u>

我々の提案した内部エネルギーの実クラ スター展開法とエントロピー項のクラスタ ー変分法(CVM)の計算で遷移金属シリサイ ドの平衡状態図を計算する準備として、2 体相互作用エネルギーの長距離性を正確に 扱う計算が必要である(J.Alloy Compound. 504S(2010),534)。、本プロジェクトでは、 テトラへドロン近似を拡張する CVM 計算プ ログラムの作成を行っている。

論文作成状況:上記の(1)-(6)の予備的結果 は金属学会で報告した。そのまとめを ICM2015 (2015/7, Spain))で発表する(学会発 表 1、論文投稿中)。(7)については、論文発 表した。(8)は金属学会で途中経過を発表し た(学会発表4)。

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雑誌論文](計5件)

C. Liu, <u>M. Asato, N. Fujima</u>, and <u>T.</u>

<u>Hoshino</u>, Full-Potential KKR Calculations for Lattice Dostortion around Impurities in Al-based Dilute Alloys, Based on the Generalized-Gradient Approximations, Trans. Mat. Res. Soc. Japan 40, 2015, in press (査読有).

<u>M. Asato</u>, C. Liu, <u>N. Fujima</u>, and <u>T.</u> <u>Hoshino</u>, Full-Potential KKR Calculations for Lattice Distortion Effect of Point Defect energies in Fe-based Dilute Alloys, Based on the Generalized-Gradient Approximation, Mater. Trans. 55 (2014), 1248-1256 (査読有).

DOI:10.2320/matertrans.M2013391

劉暢、<u>安里光裕、藤間信久、星野敏春</u> GGA-FPKKR 法による Fe 基希薄合金中の点欠 陥エネルギーの第一原理計算、日本金属学 会誌、査読有、 78 巻(2014)、235-240(査読 有).

DOI:10.2320/jinstmet.J2014019

C. Liu, <u>M. Asato, N. Fujima</u>, and <u>T.</u> <u>Hoshino</u>, Full-Potential KKR Calculations for Lattice Distortion Effect of Point Defect Energies in Fe-based Dilute Alloys, Based on the Generalized-Gradient Approximation, Mater. Trans. 54 (2013), 1667-1672 (査読有).

DOI:10.2320//matertrans.M2013176

C. Liu, M. Asato, N. Fujima, and T.

Hoshino, Full-Potential KKR Calculations for Lattice Distortion of Impurities in Fe-based Dilute Alloys, Based on the Generalized-Gradient, Proceeding of PRICM8 (2013), 2821-2824 (査読有). DOI:10.1002/9781118792148.ch349

[学会発表](計6件)

<u>M. Asato</u>, C. Liu, <u>N. Fujima</u>, <u>T. Hoshino</u>, Full-Potential KKR Calculations for Electronic and Magnetic Properties of Transition Metal Monosilicides MSi (M=Cr-Co) and Mixtures of FeSi and CoSi, Based on the Generalized-Gradient App -roximation, ICM2015, 5-10 July/ Barcelona (Spain).

C. Liu, <u>M. Asato, N. Fujima</u>, and <u>T. Hoshino</u>, Full-potential KKR Calculations for Lattice Distortion of Point Defects in Al, Based on the Generalized-Gradient Approximation, ICM2015, 5-10 July/ Barcelona(Spain).

劉暢、<u>安里光裕、藤間信久、星野敏春</u>、 第一原理電子構造計算による Al, Pd 中の単 一不純物による局所格子歪と平均体積変化、 日本金属学会、東京大学 駒場 I キャンパス、 東京都、目黒区、3月19日(2015).

<u>安里光裕</u>、劉暢、<u>藤間信久</u>、<u>星野敏春</u>、 FPKKR-Green 関数法とクラスター変分法に よる遠距離原子間相互作用エネルギーを考 慮した合金の固溶限の計算、日本金属学会、 東京大学 駒場 I キャンパス、東京都、目黒 区、3月19日(2015).

<u>星野敏春、藤間信久</u>、劉暢、<u>安里光裕</u>、 Screened-FPKKR 計算による遷移金属シリ サイド Fe_{1-c}Co_cSi のハーフメタリシティ: 規則相の電子状態密度、日本金属学会、名 古屋大学 東山キャンパス、愛知県、名古屋 市、9月25日(2014).

<u>星野敏春、藤間信久、安里光裕、</u> Screened-FPKKR計算による遷移金属シリ サイド Fel-cCocSiの磁性:原子配置依存性 と温度変化、日本金属学会、愛媛大学、愛 媛県、松山市、9月19日(2012).

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕 出願状況(計0件) 取得状況(計0件)

〔その他〕 ホームページ等 <u>http://phys.eng.shizuoka.ac.jp/~hoshino</u> <u>/indexcollab.html</u>

6 . 研究組織

(1)研究代表者
 星野 敏春(HOSHINO,Toshiharu)
 静岡大学・工学研究科・教授

研究者番号:70157014

(2)研究分担者
 藤間信久(FUJIMA, Nobuhisa)
 静岡大学・工学研究科・教授
 研究者番号:30219042

(3)連携研究者
 安里光裕(ASATO, Mituhiro)
 新浜工業高等専門学校・数理科・教授
 研究者番号:20353261